

*Поправки к статье***Золото-индуцированная кристаллизация тонких пленок аморфного субоксида кремния**

© Н.А. Лунев, А.О. Замчий, Е.А. Баранов, И.Е. Меркулова, В.О. Константинов, И.В. Корольков,
Е.А. Максимовский, В.А. Володин

В статье, опубликованной в журнале „Письма в Журнал технической физики“ (2021, том 47, вып. 14, с. 35–38. DOI: 10.21883/PJTF.2021.14.51185.18793), была допущена ошибка при указании коэффициента стехиометрии x пленок $a\text{-SiO}_x$. В работе указано значение 0.2, которое было получено из спектров пропускания инфракрасного (ИК) диапазона. Более точные измерения, проведенные с помощью методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, показали, что значение коэффициента стехиометрии x исходных пленок $a\text{-SiO}_x$ составляет 0.9. Кроме того, это позволило уточнить коэффициент пропорциональности, применяемый для определения концентрации связанного кислорода в $a\text{-SiO}_x$ методом ИК фурье-спектроскопии [1].

Так:

на с. 35, строка 3 аннотации написано: „... подложка/тонкая пленка золота/тонкая пленка $a\text{-SiO}_{0.2}$...“, должно быть: „... подложка/тонкая пленка золота/тонкая пленка $a\text{-SiO}_{0.9}$...“;

на с. 35, строка 8 сверху в правой колонке написано: „... диапазона [9] и составил 0.2“, должно быть: „... диапазона [9] и составил 0.9“;

на с. 36, строка 2 сверху в правой колонке написано: „ $a\text{-SiO}_{0.2}$ в верхнем слое образца. . .“, должно быть: „ $a\text{-SiO}_{0.9}$ в верхнем слое образца. . .“.

Эти исправления не сказываются на выводах указанной работы.

Список литературы

- [1] A.O. Zamchiy, E.A. Baranov, I.E. Merkulova, S.Y. Khmel, E.A. Maximovskiy, J. Non-Cryst. Solids, **518**, 43 (2019). DOI: 10.1016/j.jnoncrsol.2019.05.015